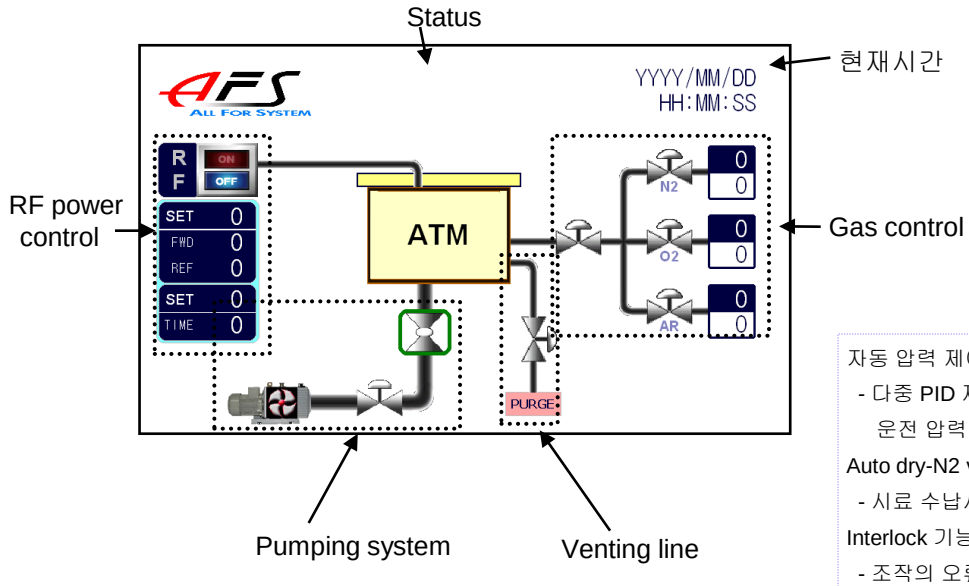
RIE(Etching) System

플라즈마 원천 기술을 가지고 Plasma Source와 RF Module 그리고 Plasma Systems를 개발 및 제작하는 업체에서 설계 및 제작 했을 뿐만 아니라 개발에도 참여한 기술진이 설립한 기업 입니다.

Vacuum 또는 Plasma Systems 및 실험용 장비 뿐만 아니라 실험을 위한 Parts 및 Module도 고객이 원하는 Concept을 최대한 반영하여 제작 가능한 기업 입니다.

편리하고 안정적인 유저 소프트웨어
(PLC Operation type ;Software and GUI for convenience and reliability operation)

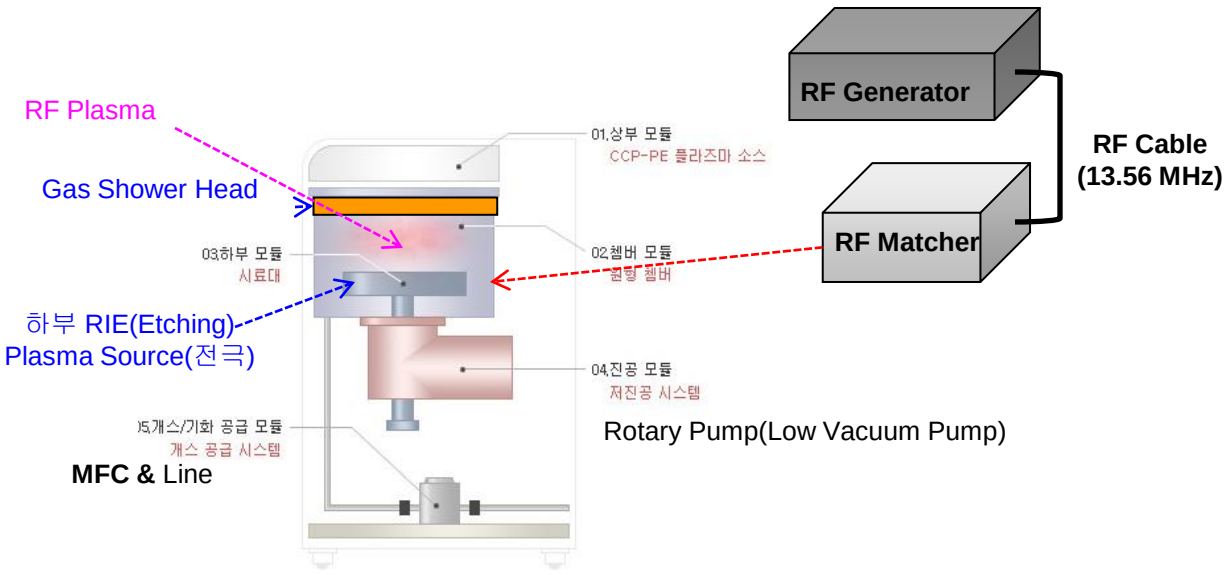


자동 압력 제어
- 다중 PID 제어를 통한 고성능 자동 압력 제어와 운전 압력 조건 유지 및 재현 실현

Auto dry-N2 vent control
- 시료 수납시 one touch vent operation 가능

Interlock 기능 강화
- 조작의 오류로 인한 사고를 방지하는 safety interlock algorithm 탑재
- 공압, 냉각수, 등의 상태를 체크하는 감지센서 탑재
- Emergency alarm 기능
- 작동상태를 명시하는 operation lamp

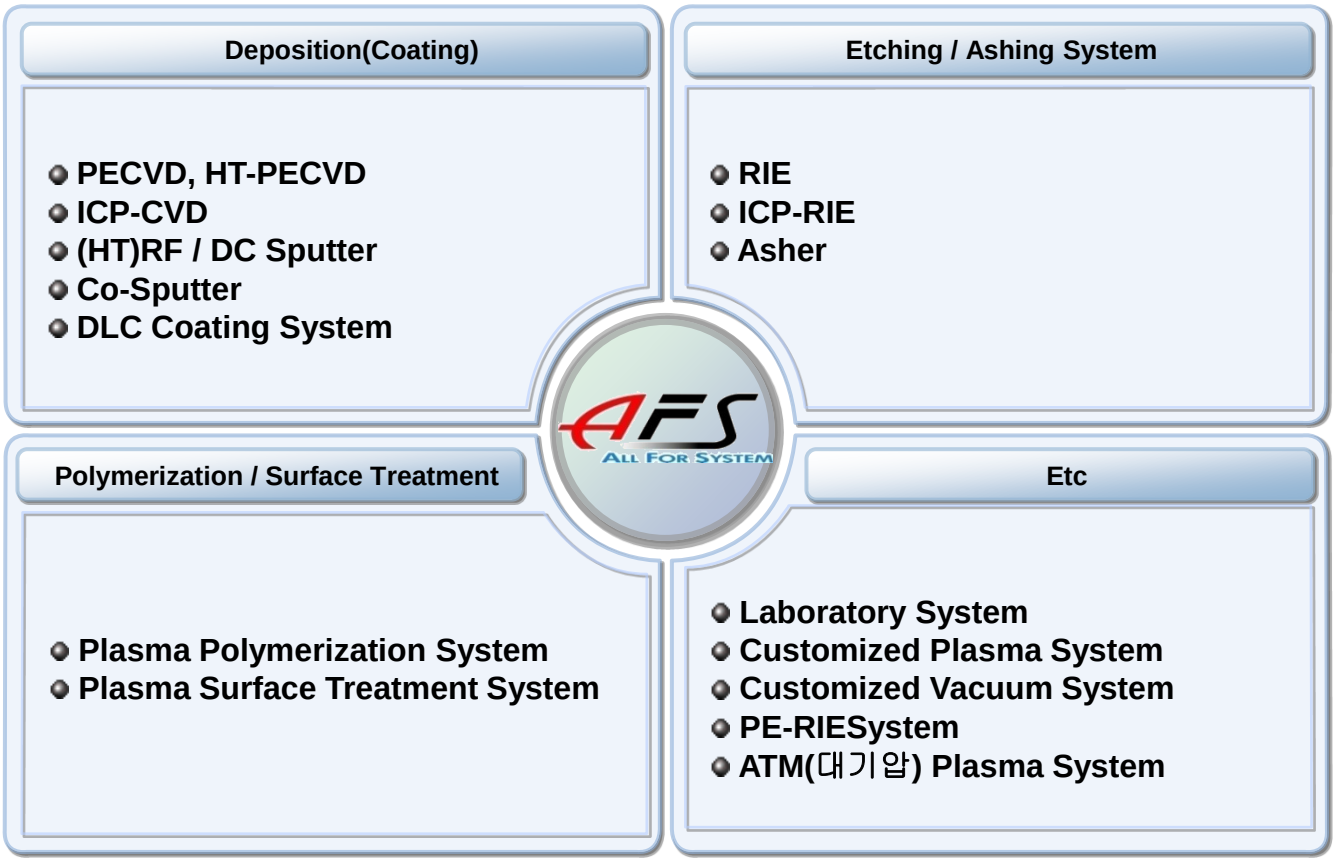
Schematic



Etching 공정을 응용 할 수 있는 분야

- 반도체: Si, Si_3N_4 Etching (한국산업기술대학교)
- 신소재: Graphene 표면 처리 및 식각
  (성균관대학교, 울산대학교,울산과학기술대학교)
- Nano Wire, 기타 연구 (고려대학교)
- Graphene, Nano, 등 관련 연구 중 (KIST)
- Polymer Etching 연구에 응용 (서울대학교)
- 기타 Soft한 Sample의 Etching은 가능함

Plasma systems for All For System



ALL FOR SYSTEM

올/포/시/스/템

For the pioneers of plasma process engineering,
supply of various plasma environments

(본사) 대전광역시 유성구 관평동 1359번지 한신에스메카 630호

TEL : 042) 933-2514 / FAX : 042) 934-2515

http://www.allfs.com

allforsystem@gmail.com